

非线性波数域的 高分辨扫频干涉层析成像

High Resolution Swept-Source Optical Coherence Tomography in Nonlinear Wavenumber Sampling

> 谢胜利/XIE Shengli,蔡树银/CAI Shuyin,白玉磊/BAI Yulei (广东工业大学,中国 广州 510006) (Guangdong University of Technology, Guangzhou 510006, China)

摘要:提出一种用于波数扫频干涉技术的超分辨层析重构方法,该方法适用于波数非线性采样 情形。通过在非线性波数域中构造干涉频谱稀疏优化模型,在此基础上采用干涉频谱矩阵优 化方法分离混叠层析干涉信号的相位场,解决因光源扫频带宽有限而导致的层析分辨能力不 足问题。数值仿真计算出本文方法的层析分辨率为3.8 μm,在光源同等带宽前提下,比传统 变换域方法提升了87%。双层结构材料轮廓重构实验验证了本文方法的有效性。

关键词:波数非线性扫频;层析分辨率;相位测量

Abstract: A method to show high resolution in swept-source optical coherence tomography is proposed. The method can handle the case of nonlinear wavenumber sampling. By constructing the sparse optimization model of interference spectrum in nonlinear wavenumber domain, the phase-field of aliasing tomography interference signal is separated by interference spectrum matrix optimization method. Therefore, the problem of poor depth resolution owing to limited light source bandwidth can be addressed. Computer simulation numerically confirmed that the depth resolution of our method is refined to be 3.8 μ m. The simulated result shows that the depth resolution is improved by 87%, compared to the traditional transform method. Furthermore, a profile measurement on the double slice sample verified the effectiveness of the presented method.

Keywords: wavenumber nonlinear scanning; depth resolution; phase measurement

波教扫频干涉是一种体块测量技 成本,通过在时间轴上对单色光 的波数进行线性调频,并使用全场干 涉和相称方法,实现透明/半透明材料 内部的三维位移场测量^[1-2]。借助于 傅里叶域锁模技术,单色光波数的扫 频速率可达400 kHz^[3],相衬方法中 的位移传感比例系数可达10⁶数量 级,位移测量灵敏度高达纳米级^[4]。

基金项目:国家自然科学基金(61705047、61727810)

波数扫频干涉技术能对材料内部在 复杂动态载荷下的力学性能进行有 效表征,是未来光测力学重要发展方 向。为此,许多学者相继开展了波数 扫频干涉技术在复合材料力学性能 分析方面的应用研究,如高分子材料 内部在动态载荷下的三维形变场分 布测量^[5]、玻璃纤维复合材料内部在 静态载荷下的应变场表征^[6]等。

在上述应用研究过程中,学者们 普遍发现波数扫频干涉在面向多层 网络出版地址:https://kns.cnki.net/kcms/ detail/34.1228.TN.20210401.1514.006.html

网络出版日期:2021-04-01 收稿日期:2021-02-25

DOI: 10.12142/ZTETJ.202102008

复杂结构材料测量时存在层析分辨 能力不足的缺点。早在2003年,波数 扫频干涉技术提出者 J. M. HUNT-LEY发现,波数扫频干涉技术的层析 分辨率与光波数扫频带宽呈反比^[1]。 为获得材料内部更高分辨率的层析 测量结果,光源波数的扫频带宽需要 足够宽,如需要采用波数扫频带宽高 达9.8×10⁵ m⁻¹的高端激光器,层析分 辨率为3.2 μm^[7]。波数扫频带宽的 扩展会产生4个关键问题:(1)超宽带 光源造价昂贵,体积庞大,不利于波数扫频干涉技术的实用化;(2)在超宽带宽光源条件下,波数关于扫频时间的高阶泰勒级数展开项不能忽略, 非线性影响严重,并会导致干涉相位 失真,位移场测量精度降低^[2];(3)需 要专门设计光路以消除宽带宽光源 导致的色散影响,但这会导致光路结 构复杂^[8];(4)层析分辨率始终面临 光源硬件瓶颈问题,提升有限。

在波数扫频干涉测量中,位移场 的解算是通过对波数域干涉信号做 傅里叶变换完成的。从信号处理角 度来看,实际应用中的傅里叶变换不 可避免地会遇到测量数据截断,即需 要对测量数据加窗。此时,信号的频 谱会卷积窗函数,从而会导致相邻谱 峰发生严重混叠。这也是波数扫频 干涉层析分辨率受限的根本原因。 为解决上述超宽带光源带来的问题, 学者们从干涉信号解调角度出发,尝 试从根本上提升层析分辨率。2015 年,K. KITAGAWA 提出用于解调干 涉信号序列的非线性优化方法[9]。 该方法本质上是在时间域中对干涉 信号的参数进行直接解算,因此能避 免傅里叶变换窗函数的卷积效应,有 望提高波数扫频干涉的层析分辨率。 在 K. KITAGAWA 思路的基础上,中 国学者 ZHANG Y. 等提出了干涉频谱 非线性优化方法。相比于传统的傅 里叶变换,该方法使得层析分辨率提 高1倍^[10]。非线性优化方法的收敛 性依赖于初始值。为克服这个缺点, 我们提出了干涉矩阵谱分解方法,在 无须预先获取波数域干涉信号频率、 相位等参数初始值的前提下,进一步 提升层析分辨率(可提升2倍)^[11]。 值得注意的是,上述非线性优化方法 和干涉矩阵谱分解均要求干涉信号 等间距采集。然而,因波数与波长之 间的倒数关系,光源波数输出序列呈

现出非线性的特点,这使得干涉信号 采样过程呈现出非等间距的特点。 为使用上述的层析分辨率提高算法, 需要对波数域干涉信号进行插值,将 干涉信号的非等间距采样转化为等 间距采样。但是,插值处理会对干涉 信号起到平滑作用,易丢失干涉信号 高频信息。高频信息的丢失意味着 材料内部深度区域无法清晰成像。 另外,由于未考虑测量噪声结构特 点,插值在强散斑噪声情况下容易导 致干涉信号失真。目前,尚未有相关 文献报道直接用于非等间距采样下 的层析分辨率提高方法。

本文提出一种非等间距采样下 的干涉频谱计算新方法,该方法能在 使用波数非线性扫频和无须更改波 数扫频干涉测量系统的前提下,较大 幅度提升波数扫频干涉的层析分辨 率。计算机仿真给出了该方法的层 析分辨率数值解,实验模拟的双层结 构材料轮廓测量结果验证了该方法 的有效性。

1 波数扫频干涉测量原理

设材料内部由 M个界面层构成, 每个界面层之间的光学折射率均不 同。当激光照射到材料内部 M个界 面层时,会发生反射,而反射信号相 互叠加后在数码相机像平面上成像 并产生干涉信号^[12]:

$$I(x, y, k) = \sum_{p=1}^{M} I_p(x, y) +$$

$$2 \cdot \sum_{p=1}^{M-1} \sum_{q=p+1}^{M} \sqrt{I_p(x, y) \cdot I_q(x, y)} \cdot$$

$$\cos \left[2 \cdot k \cdot \Lambda_{pq}(x, y) \right]_0$$
(1)

在公式(1)中,(x,y)为空间坐标;k为 激光波数;下标p、q分别代表界面层 S_p 和 S_q ;I为反射光强; Λ_{pq} 为界面层 S_p 和 S_q 之间的光程差,代表材料内部轮 廓和受外力载荷下的变形信息, Λ_{pq} 为待求解参数。波数扫频干涉测量 需要对波数 k进行时间调谐,以便于 在时间轴上增加新的观测信息,用于 解算光程差 $\Lambda(x, y)$,即:

$$\begin{cases} I(x, y, n) = \sum_{p=1}^{M} I_p(x, y) + 2 \cdot \sum_{p=1}^{M-1} \sum_{q=p+1}^{M} \sqrt{I_p(x, y) \cdot I_q(x, y)} \cdot \\ \cos\left\{2\pi \cdot f_{pq}(x, y) \cdot [k(n) - k(1)] + \phi_{pq}(x, y)\right\} & \circ \\ f_{pq}(x, y) = \frac{\Lambda_{pq}(x, y)}{\pi} \\ \phi_{pq}(x, y) = 2k(1) \cdot \Lambda_{pq}(x, y) \end{cases}$$

(2)

在公式(2)中,n = 1, 2, ..., N为数码 相机在波数扫频过程中的拍摄序列 索引值; $\Delta k = k(N) - k(1)$ 为光波数扫 频带宽。公式(2)中的干涉频率 f_{pq} 和 相位项 ϕ_{pq} 均包含待求解的光程差信 息,且映射关系为比例关系。由于干 涉频率项的比例系数仅为 $1/\pi$,而干 涉相位项的比例系数 k_0 数量级为 10^6 ,测量灵敏度高。故波数扫频干涉 技术采用相位测量方式以实现材料 载荷下的轮廓场或形变场重构。

公式(2)中的波数 k(n)分布为非 等间距。考虑到插值本身所带来的 影响,我们不考虑插值处理,而采用 非等间距傅里叶变换计算干涉 相位^[8]:

$$\tilde{I}_{FT}(x, y, f) = \sum_{n=1}^{N} I(x, y, n) \cdot \exp\{j \cdot 2\pi f \cdot [k(n) - k(1)]\}_{\circ}$$
(3)

在公式(3)中,*f*表示傅里叶变换域中 的频率点。由于干涉信号为周期信 号,其频谱理论上为离散谱,相位谱 在谱峰位置的数值即为干涉相位。 受窗函数卷积运算影响,式(3)由原 来的狄拉克δ函数变为辛格sinc函 数,这会导致干涉主瓣变宽。此时, 相邻干涉谱峰易发生混叠,层析分辨 率降低。另外,sinc函数也会导致干 涉旁瓣的存在、相位测量精度的降 低。尽管可以通过加汉宁窗压制干

非线性波数域的高分辨扫频干涉层析成像 ZTE TECHNOLOGY JOURNAL

涉旁瓣,但这会导致干涉主瓣拓宽1 倍,进而破坏层析分辨率。

2基于频谱稀疏性的干涉相位 重构

由前文可知,干涉频谱理论上为 离散谱,它在频域上具有稀疏的特 点。本文中,我们利用干涉频谱的稀 疏特征,并采用最小二乘法在波数域 中构建如下优化模型:

$$\begin{cases} \min \sum_{n=1}^{N} \begin{cases} I(x, y, n) - \left| \tilde{I}_{LSA}(x, y, f) \right| \cdot \\ \cos \left\{ 2\pi f \cdot [k(n) - k(1)] + \\ \Phi(x, y, f) \right\} \end{cases}^{2} & (4) \\ \\ \Phi(x, y, f) = \tan^{-1} \left\{ \frac{\operatorname{Re}\left[\tilde{I}_{LSA}(x, y, f) \right]}{\operatorname{Im}\left[\tilde{I}_{LSA}(x, y, f) \right]} \right\} \end{cases}$$

在公式(4)中,Re和Im分别表示复数 的实部和虚部, $\tilde{I}_{LSA}(x,y,f)$ 表示待估 算的干涉频谱。由式(4)可知,当干 涉频谱在干涉频率外的其他频率区 域存在幅值与相位时,那么误差方程 中必然会引入新的正弦波,这会导致 误差变大。因此,式(4)所估算的干 涉频谱接近真实线谱,避免了变换域 算法中的窗函数卷积运算,解决了干 涉频谱混叠所导致的层析分辨能力 不足的问题。式(4)优化模型不需要 波数k(n)等间距采样,适用于波数非 线性扫频的情形。

为求解上述优化问题,考虑某个 空间位置(x, y)下的特定频率点 f_i,将 式(4)展开为干涉频谱稀疏优化矩阵 模型:



设公式(5)中的系数矩阵为A₁,包含

干涉幅频和相频的待求解参数向量 为 X_i ,那么对于每个频率点 f_i 下的最 优估计可由矩阵最小二乘算法得到。 对所有频率点都做上述处理,可以得 到向量 $X(f_i)$, $I=1, 2, \cdots, L$ 的序列

到向量 $X(f_l)$, l=1, 2, ..., L的序列 值。通过计算向量的模长,可以重构 出干涉幅频 $|\tilde{I}_{LSA}(x, y, f_l)|$ 。由于所提 方法计算的干涉幅频能量集中,旁瓣 干扰较少,因此容易分辨出相邻谱峰 位置并得到该位置处的干涉频率 f_{pk} 。 谱峰识别分辨过程相当于沿深度方 向对材料内部界面层进行定位。在 此基础上,我们可计算出点(x, y)处 某个深度位置的干涉相位场:

$$\phi = \tan^{-1} \left[\frac{-X_2(f_{pk})}{X_1(f_{pk})} \right]_{\circ}$$
(6)

公式(6)中,实数 X_1 和 X_2 分别对应向 量X中的两个元素。从上述优化过 程可看出,文中所提的方法无须迭代 初始值,因此在实际测量中无须预先 获取材料内部的粗略结构信息,算法 收敛性和实用性均较强。

3 计算机仿真

在波数扫频干涉中,层析分辨率

对应于干涉主瓣的半高宽度^[2]。对 于非等间距傅里叶变换,层析分辨率 数值可通过计算 sinc 函数的主瓣半 高宽度所得,如公式(7)。对于本文 所提方法,因稀疏优化后的干涉主瓣 数学方程难以建模,其层析分辨率需 通过数值方法来确定。本节中,我们 通过计算机仿真数值计算本文方法 的层析分辨率,并对比该方法和非等 间距傅里叶变换的层析分辨能力。

$$\delta z_{FT} = \frac{\pi}{\Delta k} \,^{\circ} \tag{7}$$

仿真中的光源参数可以参照 BS-785-1 (SUPERLUM Co. Ltd.)^[13] 中的 信息:中心波长为 785 nm,波长扫频 带宽为 50 nm。通过换算可得波数扫 频带宽 $\Delta k = 5.10 \times 10^5$ m⁻¹。仅考虑 B-Scan(截面)情形,我们模拟深度方向 上由两个界面层所构成的被测材料, 如图 1(a)所示。其中,界面层轮廓建 模为两个倾斜方向相反的直线,界面 层之间的距离从 0 µm 增至 20 µm。 仿真中添加的高斯白噪声用于模拟 数码相机采集过程中所产生的背景 噪声。图 1(c)为非等间距傅里叶变 换重构的相位分布(解包裹后)。根



ZTE TECHNOLOGY JOURNAL

据公式(2),该相位值可反映为两个 界面层的轮廓。对比图1(a)可知,当 界面层之间的距离小于7.1 um时,非 等间距傅里叶变换重构的两个界面 层的相位混叠为单个相位值。于是, 在本次仿真中可确定,非等间距傅里 叶变换的层析分辨率为7.1 μm。将 $\Delta k = 5.10 \times 10^5 \,\mathrm{m}^{-1}$ 代入到公式(7)中, 可得非等间距傅里叶变换层析分辨 率理论值(6.2 µm)。图1(b)为使用 本文方法重构的界面层相位分布。 类似于图1(c)的分析过程,当界面层 之间的距离小于3.8 µm时,使用本文 方法重构的界面层相位与实际轮廓 情况不符,因此我们可确定该仿真中 的干涉频谱最小二乘法层析分辨率 为3.8 µm。仿真结果表明,与非等间 距傅里叶变换相比,本文所提的方法 在波数非线性扫频前提下,使层析分 辨率提高87%。

4 实验验证

图 2 为我们搭建的波数扫频干涉 测量系统原理图,其中扫频光源型号 为计算机仿真中采用的 BS-785-1 (SUPERLUM Co. Ltd.),数码相机为 近红外互补金属氧化物半导体 (CMOS)相机。由光纤光源输出(LO 2)、透镜组 $L_1 \sim L_4$ 、正方体分光棱镜 (CBS)、反射镜R和相机(CMR1)构成 的迈克尔逊式干涉仪光路,可以用于 测量材料内部的轮廓或形变场。由 LO1、透镜组L₅和L₆、光楔(OW)和相 机 CMR2构成的斐索式干涉仪光路 用于实时监测扫频光源的波数输 出^[8],监测结果可为非等间距傅里叶 变换和本文方法提供自变量k信息。 通过光源的触发信号进行同步触发, 两个相机在光波数扫频过程中共拍 摄了2000张干涉条纹图像。

如图3(b)所示,实验中我们将

USAF 1951级分辨率板与载玻片放置 于样品载物台上,然后调整千分尺加 载头,以使分辨率板和载玻片之间的 间隙保持在约为6μm。分辨率板和 载玻片组成的整体可用于模拟双层 结构材料。本次实验的目的是比较 非等间距傅里叶变换方法和本文所 提的方法,以明确哪一个能分辨出载 玻片和分辨率板之间的间隙。图 3 (c)为通过斐索式干涉仪光路监测得 到的光源波数输出序列,差分处理后 可得到波数采样间隔步长,如图 3(d)







▲图3 被测件及波数监测结果

ZTE TECHNOLOGY JOURNAL

所示。图 3(c)中的波数扫频范围监 测结果为 $\Delta k = 5.10 \times 10^5 \, m^{-1}$,与该光源 带宽和中心波长参数所计算的理论 值相吻合。从图 3(d)结果中可看出, 光波数采样间隔呈现散点图状态,并 非固定于某个值。这证明光源波数 扫频过程中存在非线性现象,且该现 象在波数起始扫频阶段较为严重。 为方便以下讨论,玻璃后表面记为 S₂,USAF 1951级分辨率板前后表面 分别记为 S₃和 S₄。根据前文介绍的 分辨率板和载玻片之间微米级间隙

距离,我们重点考虑干涉谱 峰S24和S34情况。图4(a)为 CMR1 相机拍摄到的 2 000 张干涉条纹序列,选取如图 所示的感兴趣区域(ROI), 再依据式(3)对该区域上的 每个像素点沿波数轴做非 等间距傅里叶变换,可得到 波数非线性扫频下的干涉 频谱。图4(b)为x = 1 mm 处的截面结果,从图中可看 出因S24和S34之间的间距接 近于非等间距傅里叶变换 的分辨率6.2 µm,干涉谱峰 S24和S34接近混叠。这表明 该分辨率下,非等间距傅里 叶变换只能粗略定位到界 面层S24和S34。根据本文方 法计算的干涉频谱如图4 (c)所示,其稀疏性好于非等 间距傅里叶变换。更好的 稀疏性意味着干涉主瓣宽 度较窄且旁瓣峰值较低。 因此,采用本文方法后,在 原先接近干涉谱峰混叠的 地方能清晰分辨出S24和S34。 该组实验结果证实,本文所 提方法的分辨率高于非等 间距傅里叶变换。

为进一步考察本文所

提方法在改进层析分辨能力方面的 效果,我们截取前1700个点的干涉 信号。此时,波数扫频带宽缩减为 4.23×10⁵m⁻¹。非等间距傅里叶变换 层析分辨率降为7.41 μm。该值大于 分辨率板和载玻片之间的间距,因此 在干涉频谱上会出现谱峰S₂₄和S₃₄完 全混叠为单峰的情形,如图5(a)所 示。通过提取峰值处的干涉相位值, 可得S₂₄和S₃₄的全场包裹相位分布, 如图5(c)、(d)所示。其中图5(c)代 表S₂₄,图5(d)代表S₃₄。根据图3(b) 中的被测件放置情况,载玻片后表面 与分辨率板后表面之间存在倾角;而 为校准成像系统的性能,分辨率板前 后表面之间的倾角几乎不存在。因 此,S₂₄包裹相位值会跨越多个2π周 期,而S₃₄包裹相位值会停留在某个相 位值附近。另外,由于分辨率板图案 在玻璃基底上镀铬,光波无法穿透图 案照射到玻璃基地上,而带有图案部 分的分辨率板前后表面以及它们与 载玻片后表面之间均无法产生干涉 信号;因此,带有图案"4"的相位值是









随机分布的。从图5(c)、(d)结果可 看出, S24和S34的包裹相位场因谱峰 完全混叠而导致变化相差不大。这 表明非等间距傅里叶变换层析分辨 率较低,无法实现S24和S34的轮廓场 重构。图5(b)为采用本文方法计算 出的S₂₄和S₃₄干涉谱峰情况,从图中 可看出原先混叠的干涉谱峰已成功 分离。图5(e)、(f)为在本文方法计 算的在干涉谱峰处所提取的S24和S34 包裹相位场,其中S24在无图案处的相 位值跨越了约2个2π周期。由此可 估算出玻璃后表面与分辨率板后表 面的光程差变化最大值恰好为光源 的中心波长,即785 nm;而S₃₄在无图 案处的相位值绝大部分集中在"0"附 近,这也证实分辨率板前后表面几乎 无倾角。根据计算机仿真结果,并考 虑到层析分辨率(约为4 µm),该实验 验证了本文方法能成功应用于间隙 为6µm的界面层轮廓重构。综上所 述,实验结果证实本文方法能在波数 非线性输出下,有效提高波数扫频干 涉测量的层析分辨率。

5 结束语

波数扫频干涉测量技术因具备 全场、动态、高灵敏测量特点,成为前 沿的内部力学量演化原位表征技术 之一。然而受光源带宽上限的限制, 波数扫频干涉测量的层析分辨率较 低,无法分辨出材料内部间距离小于 5 µm的界面层。本文从信息处理角 度出发,提出一种适用于波数非线性 扫频下的层析分辨率提高方法。借 助干涉频谱稀疏特点,该方法构造出 干涉频谱稀疏优化模型,并采用干涉 频谱矩阵最小二乘完成稀疏优化,实 现高分辨层析相位重构。在无须任 何先验信息的前提下,该方法解决了 因光源扫频带宽有限而导致的层析 分辨能力不足的问题。计算机仿真 数值计算出本文方法的层析分辨率 为 3.8 µm,在光源同等带宽的前提 下,比传统方法提升了 87%。实验结 果验证了本文方法能有效提升波数 扫频干涉的层析分辨能力和相位测 量精度。另外,本文方法无须更改波 数扫频干涉测量系统硬件,且层析分 辨率改善方式简单有效,因此有望在 将来取代基于传统傅里叶变换的扫 频干涉信号解调方法。未来,我们将 尝试将其应用于多层复杂结构材料 内部的微米级层间间距界面层形变 全场测量。

参考文献

- RUIZ P D, ZHOU Y Z, HUNTLEY J M, et al. Depth-resolved whole-field displacement measurement using wavelength scanning interferometry [J]. Journal of optics A: pure and applied optics, 2004, 6(7): 679–683. DOI: 10.1088/1464–4258/6/7/004
- [2] RUIZ P D, HUNTLEY J M, WILDMAN R D. Depth-resolved whole-field displacement measurement by wavelength-scanning electronic speckle pattern interferometry [J]. Applied optics, 2005, 44(19): 3945–3953
- [3] BIEDERMANN B R, WIESER W, EIGENWIL-LIG C M, et al. Dispersion, coherence and noise of Fourier Domain Mode Locked (FD-ML) lasers [J]. CLEO/Europe – EQEC 2009 – European conference on lasers and electrooptics and the European quantum electronics conference, 2009: 1. DOI: 10.1109/CLEOE– EQEC.2009.5192900
- [4] TAN J, BAI Y L, DONG B, et al. Phase noise reduction in wavelength scanning interferometry using a phase synthesis approach [J]. Optics communications, 2020, 475: 126295. DOI: 10.1016/j.optcom.2020.126295
- [5] CHAKRABORTY S, RUIZ P D. Measurement of all orthogonal components of displacement in the volume of scattering materials using wavelength scanning interferometry [J]. Jour– nal of the optical society of America a optics image science & vision, 2012, 29(9): 1776– 1785
- [6] LIU Y, DONG B, BAI Y, et al. Perspective measurement of the out-of-plane displacement and normal strain field distributions inside glass fibre-reinforced resin matrix composite [J]. Strain, 2015, 51(3): 198–205. DOI: 10.1111/str.12133
- [7] DAVILA A, HUNTLEY J M, PALLIKARAKIS C, et al. Wavelength scanning interferometry using a Ti: Sapphire laser with wide tuning range [J]. Optics and lasers in engineering, 2012, 50(8): 1089–1096. DOI: 10.1016/j.opt– laseng.2012.02.005
- [8] XU J X, LIU Y F, DONG B, et al. Improvement of the depth resolution in depth-resolved

wavenumber-scanning interferometry using multiple uncorrelated wavenumber bands [J]. Applied optics, 2013, 52(20): 4890–4897

- [9] KITAGAWA K. Surface and thickness profile measurement of a transparent film by threewavelength vertical scanning interferometry [J]. Optics letters, 2014, 39(14): 4172–4175
- [10] ZHANG Y, BAI Y L, XU J X, et al. Effective improvement of depth resolution and reduction of ripple error in depth-resolved wavenumber-scanning interferometry [J]. Optics and lasers in engineering, 2015, 66: 58-63. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2014.08.009
- [11] BAI Y L, HE Y M, BAO H, et al. Eigenvalue decomposition and least squares algorithm for depth resolution of wavenumber-scanning interferometry [J]. Journal of the optical society of America a optics image science & vision, 2015, 32(7): 1352–1356. DOI: 10.1364/JOSAA.32.001352
- [12] DÁVILA A. Wavelength scanning interferometry using multiple light sources [J]. Optics express, 2016, 24(5): 5311–5322. DOI: 10.1364/oe.24.005311
- [13] Superluminescent diodes [EB/OL]. [2021– 02–22]. https://www.superlumdiodes.com/

